



## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ОСАЖДЕНИЯ СЛОЕВ МЕТОДАМИ ALD И CVD

# МВУ ТМ ИЗОФАЗ 03

### Назначение:

Осаждение сверхтонких слоёв.



### СХЕМА УСТАНОВКИ



### Особенности:

- Рабочая поверхность стола-ВЧ электрода  $\varnothing 180$  мм;
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электроде – подложкодержателе в диапазоне от 0 до 1000 В;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ электрода-подложкодержателя в диапазоне 30-200 Вт;
- Нагрев ВЧ электрода-подложкодержателя до 300 °С;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ ICP источника плазмы в диапазоне 400-600 Вт;
- Безмасляная система откачки (ТМН300);
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 3 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой  $\sim 2,5$  м<sup>2</sup>.